

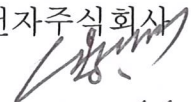
## 데모 계약서 YOUNGDAUM


경기도 화성시 태안읍 반월리 산 16번지에 주사무소를 두고 있는 삼성전자 주식회사 (이하 "삼성"이라 칭함)와 경기도 평택시 지체동 33번지에 위치한 (주)아이피에스사 ("IPS")는 2002년 8월 19일 ("계약발효일")부로 다음과 같이 계약 ("계약서")을 체결한다.

1. IPS는 양산성 검증을 위해 IPS가 소유하고 있는 Nano-ALD 3000장비(Flow type chamber & Shower Head type chamber포함)를 300mm  $Al_2O_3$ ,  $Al_2O_3+TiO_2$  ALD공정평가를 위해 삼성에게 계약발효일로부터 12개월 ("계약기간")동안 무상 임대한다.
2. 삼성 및 IPS는 계약기간 동안 상호 기술 정보 교환 등을 통해, 별첨1,2의 역할 분담 및 평가일정에 따라  $Al_2O_3$ ,  $Al_2O_3+TiO_2$  Process평가를 실시하며 Chamber Dry Cleaning개발 및 One Chamber  $Al_2O_3+TiO_2$  Process 개발도 추가 실시한다. 단, 계약기간 중에 평가가 완료되지 않은 경우 양사 합의에 의해 본 계약기간을 연장할 수 있다. 본 계약상의 평가를 수행하기 위하여 발생하는 비용은 별첨1의 역할분담에 따라 각자 부담한다.
3. 삼성과 IPS는 계약기간 중에 상호 교환하는 각종 기술자료 ("비밀정보")를 본 계약 외에 다른 목적으로 사용할 수 없으며 본 계약발효일로부터 2년간 상대방의 사전 서면 동의없이 제3자에게 공개할 수 없다.
4. 본 계약기간 중에 특허를 포함한 지적재산권이 발명되는 경우 발명자 우선주의에 따라 각사 독자 발명의 경우는 독자소유, 양사 공동 발명의 경우는 공동소유로 각각 간주한다.
5. 제공된 장비의 반환 또는 구매 여부에 대해서는 평가가 완료되고 나서 삼성이 결정하는 것으로 한다. 단, 삼성이 장비를 구매하는 경우 데모장비 및 이후 장비에 대해서도 가격 및 납기 측면에서 최혜조건으로 제공한다.

6. 양 사는 상대방의 사전 서면 동의 없이 본 계약 체결 사실 또는 계약 내용에 대해 대외 홍보할 수 없다.

본 계약이 체결되었음을 증명하고 성실히 이행하기 위하여 양사는 본 계약서 2부를 작성하여 각자 공인된 대표의 상호 날인 후 1부씩 보관한다.

삼성전자주식회사  
서명:   
성명: 이 선용  
직위: 상무

(주)아이피에스  
서명:   
성명: 홍 금태  
직위: 京畿道 平澤市 芝制洞 33  
(株)아이피에스  
代表理事 李鎔漢

#### 별첨1. 역할분담

##### ① 삼성:

- TEST에 필요한 TEST WAFER 제공
- UTILITY구성에 필요한 PARTS 제공
- DEMO 설비 평가

##### ② IPS:

- DEMO 설비 및 Set-Up & Maint에 필요한 인력과 제반 부대설비(pump, gas detector, scrubber 포함) 및 소모품 (source 포함) 제공
- DEMO 설비 반입 및 DEMO 완료 후 반출을 위한 제반 비용 부담

#### 별첨2. 평가일정

DATE	단계	Comment
2002. 08.19	설비 도입 (Back-bone + T/W type 1 chamber)	Gas box내 Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> system, TiO <sub>2</sub> system 포함
2002. 08.19 ~ 2003. 08.18	T/W type Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> +TiO <sub>2</sub> 평가	T/W chamber confirm시 S/H type 은 Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , T/W는 TiO <sub>2</sub> 로 사용
2002. 09.30	S/H type 1 chamber 추가 도입	Gas box내 Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> system, TiO <sub>2</sub> system 포함
2002. 09.30 ~ 2003. 08.18	S/H type Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> +TiO <sub>2</sub> 평가	T/W chamber confirm시 S/H type 은 Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , T/W는 TiO <sub>2</sub> 로 사용
2003. 04.15 ~ 2003. 08.18	1 chamber 평가	
2003. 07.01 ~ 2003. 08.18	Chamber dry cleaning 평가	IPS에서 사전 평가 완료 후, 삼성에서 평가 시작